PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-269185

(43) Date of publication of application: 05.10.1999

(51)Int.CI.

CO7F 15/00 B01J 31/24 CO7C 29/136 CO7C 31/20 CO7C 67/333 CO7C 69/716 // CO7B 61/00

(21)Application number: 10-092174

(71)Applicant: TAKASAGO INTERNATL CORP

(22) Date of filing:

23.03.1998

(72)Inventor: SAYO NOBORU

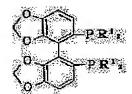
SAITO TAKAO

YOKOZAWA TORU

(54) RUTHENIUM-PHOGPHINE COMPLEX AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a ruthenium-phosphine complex which is stable and has high catalytic activity. SOLUTION: This complex shown by the formula $[[RuX(L)]2(\mu - X)3]$ - $[R22\ NH2]$ + $[R2\ is\ H,\ a\ 1-5C\ alkyl,\ a\ cycloalkyl,\ or\ the\ like;\ L\ is\ a\ diphosphine\ ligand\ shown\ by\ the\ formula\ [R1\ is\ a\ (substituted)\ phenyl,\ naphthyl,\ or\ the\ like;\ X\ is\ a\ halogen!\ (e.g.\ [[RuCl((S)-SEGPHOS)]2(\mu-Cl)3]-[Et2NH2]4)\ is\ obtained\ by\ reacting\ a\ ruthenium\ complex\ shown\ by\ the\ formula\ [RuX(arene)\ (L)]X\ [X\ is\ a\ halogen;\ arene\ is\ a\ (substituted)\ phenyl;\ L\ is\ a\ tertiary\ diphosphine\ ligand\ shown\ by\ the\ formula\ with\ an\ ammonium\ salt\ of\ the\ formula\ R22NHHN.\ The\ ruthenium\ complex\ shown\ by\ the\ formula\ [RuX(arene)(L)]X\ is\ obtained\ by\ reacting\ [RuCl2(arene)]2\ with\ a\ tertiary\ duphosphine\ L\ in\ a\ solvent\ such\ as\ methanol\ at\ 20-50°\ C\ for\ 1-3\ h\ when\ X\ is\ chlorine.$



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

12.06.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the

examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(11)特許出願公開番号

特開平11-269185

(43)公開日 平成11年(1999)10月5日

| (51) Int. Cl. 6 | 識別記号 | 庁内整理番号 | FI | | | | 技術表示箇所 |
|-----------------|-----------|--------|------------|--------------------|-------|--------|-------------|
| C07F 15/00 | | | C07F 15/00 | | | A | |
| B01J 31/24. | | | B01J 31/24 | | | Z | |
| C07C 29/136 | | | CO7C 29/13 | 6 | | | |
| 31/20 | | | 31/20 | | | Z | |
| 67/333 | | | 67/333 | | | | |
| | | 審査請求 | 未請求 請求 | 項の数4 | F D | (全7頁) | 最終頁に続く |
| (21)出願番号 | 特願平10-92 | 174 | (71)出願人 | 0001 | 694 | 6 6 | |
| | | | | 高砂香料工 | 工業株 | 式会社 | |
| (22)出願日 | 平成10年(199 | | 東京都大E | 田区蒲 | 田五丁目3 | 7番1号 | |
| | | | (72)発明者 | 佐用 昇 | | | |
| | | | | 神奈川県3 | 平塚市 | 西八幡1丁目 | 目 4 番 1 1 号 |
| | | | | 高砂香料工業株式会社総合研究所内 | | | |
| | | | (72)発明者 | 齊籐 隆き | 夫 | | |
| | | | | 神奈川県平塚市西八幡1丁目4番11号 | | | |
| r | | | | 高砂香料工業株式会社総合研究所内 | | | |
| | | | (72)発明者 | 横澤 亨 | | | |
| | | | | 神奈川県马 | 平塚市i | 西八幡1丁目 | 目 4 番 1 1 号 |
| | | | | 高砂香料工 | 工業株: | 式会社総合研 | 开究所内 |
| | | | (74)代理人 | 弁理士 泊 | 度辺 - | 一雄 | |
| | | | 1 | | | | |

(54) 【発明の名称】ルテニウム-ホスフィン錯体及びその製造方法

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 高い不斉収率を得る触媒として有用な新規ルテニウム-ホスフィン錯体、並びに精製を必要としない当該錯体の製造方法の提供。

【解決手段】 一般式(1)、

[$\{RuX(L)\}_{z}(\mu-X)_{z}$] [$R^{2}zNH_{z}$]

(R) は、水素、炭素数1~5のアルキル基、シクロアルキル基、置換基を有してもよいフェニル基、置換基を

有してもよいベンジル基、Lは、一般式(2)、

(R' は置換基を有してもよいフェニル基、ナフチル基、シクロヘキシル基、シクロベンチル基。) で表されるジホスフィン配位子、X はハロゲン原子。) で表されるルテニウムーホスフィン錯体、並びに、原料として、[RuX(arene)(L)]X (X, arene, L 及びR' は上記と

同じ。)で表されるルテニウム錯体と、R¹,NH・HX (X及びR¹ は上記と同じ。)で表されるアンモニウム 塩とを用いて反応させる上記一般式(1)で表されるル テニウムーホスフィン錯体の調製方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式(1)、

 $[\{RuX(L)\}, (\mu-X), \}, (R^2, NH_2)^+$ (1)

(式中、R² は、水素、炭素数1~5のアルキル基、シクロアルキル基、置換基を有してもよいフェニル基、置換基を有してもよいスンジル基を表し、Lは、一般式(2)、

【化1】

$$\begin{array}{c}
0 \\
0 \\
PR^{1_{2}}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
0 \\
PR^{1_{2}}
\end{array}$$

(式中、R¹ は置換基を有してもよいフェニル基、ナフチル基を表すか、シクロヘキシル基、シクロペンチル基を表す。)で表されるジホスフィン配位子であり、Xはハロゲン原子を意味する。)で表されるルテニウムーホスフィン錯体。

【請求項2】 一般式(3)、

$$[RuX(arene)(L)]X$$
 (3)

(式中、Xはハロゲン原子を表し、arene は置換基を有してもよいフェニル基を表し、Lは一般式(2)、

[化2]

$$\begin{array}{c}
0 \\
0 \\
PR^{1}
\end{array}$$
(2)

(式中、 R^1 は置換基を有してもよいフェニル基、ナフチル基を表すか、シクロヘキシル基、シクロペンチル基を表す。)で表される三級ジホスフィン配位子を意味する。)で表されるルテニウム錯体と、一般式(4)、 R^1 、 $NH \cdot HX$

(式中、 R^1 は、水素、炭素数 $1\sim5$ のアルキル基、シクロアルキル基、置換基を有してもよいフェニル基、置換基を有してもよいベンジル基を表し、X はハロゲン原子を意味する。)で表されるアンモニウム塩とを反応させることを特徴とする、一般式(1)、

$$(RuX(L))_{2}(\mu-X)_{3}$$
 $(R^{2},NH_{2})^{+}$ (1)

で表されるルテニウムーホスフィン錯体の調製方法。

【請求項3】 一般式(5)、

$$(RuX2 (arene))2$$
 (5)

(式中、Xはハロゲン原子を表し、arene は置換基を有してもよいフェニル基をを意味する。) で表されるルテニウム錯体と、一般式(2)、

【化3】

(式中、R¹ は置換基を有してもよいフェニル基、ナフ チル基を表すか、シクロヘキシル基、シクロペンチル基 を表す。)で表される三級ジホスフィン配位子と、一般 10 式(4)、

$$R^2$$
, $NH \cdot HX$ (4)

(式中、R' は水素、炭素数 $1\sim5$ のアルキル基、シクロアルキル基、置換基を有してもよいフェニル基、置換基を有しても良いベンジル基を表し、X はハロゲン原子を意味する。)で表されるアンモニウム塩とを反応させることを特徴とする、一般式(1)、

 $\{\{RuX(L)\}, (\mu-X), \}$ $\{R', NH, \}$ (1) で表されるルテニウムーホスフィン錯体の調製方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、下記の一般式 (1)、

 $\{\{RuX(L)\}\}, (\mu-X), \}$ $\{R^{i}, NH, \}$ (1) で表される新規なルテニウムーホスフィン錯体及び当該 錯体からなる不斉水素化触媒に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、遷移金属錯体を触媒とする有機合成反応が数多く開発され、多くの目的のために活用されてきた。特に、不斉水素化反応等に用いられる不斉触媒について数多くの報告がなされている。不斉水素化触媒として、ロジウム原子と光学活性ホスフィンを配位子とする錯体を選択使用し、光学純度の高い不斉水素化物を調製することが報告されてから、遷移金属原子と光学活性ホスフィンとから構成される錯体を不斉水素化触媒とする研究が数多く報告されている。

【0003】例えば、J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1 40 985 年、922 頁及びJ. Chem. Soc.Perkin Trans. I, 19 87 年、1571頁には、2, 2'ーピス(ジフェニルホスフィノ)-1, 1'ーピナフチルールテニウム錯体(Ru,Cl,(BINAP),・Et,N、以下、BINAP-Ru錯体という)を使用し、アシルアミノアクリル酸誘導体を水素化して、光学活性なアミノ酸誘導体を製造する技術が開示されている

【0004】最近、Organometallics, 1996年、15巻、1521頁には、p-MeO-BINAP のルテニウム錯体〔{RuCl(p-MeO-BINAP)},(μ-Cl),〕 〔Et,NH.〕 が報告され 50 ている。また本件と同一出願人による特願平8-359

3

818号には、((5,6),(5',6')ービス (メチレンジオキシ)ビフェニルー2,2'ージイル) ビス(ジフェニルホスフィン)ールテニウム錯体(以下、SEGPHOS-Ru錯体という)を使用し、ケトン類の不斉 水素化反応が開示されている。

[0005] しかしながら、ここで用いられているルテニウム錯体は、錯体の調製が繁雑であったり、錯体の収率、安定性に問題があったり、複雑な混合物になったりし、触媒活性及びその持続性についても、充分であるとはいえない。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】ルテニウム金属は、遷移金属のなかでは比較的安価であり、工業的に有利な触媒として期待されるが、反応の精密化及び応用の点で、問題が残されている。従って、容易に作ることができ、安価で、活性が高く、かつ持続性があり、しかも不斉反応における高い不斉収率、すなわち、生成物の光学純度が高いものを得ることができる触媒が要求されていた。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、このような工業界の要請にこたえるべく研究を重ねた結果、錯体中の配位子に光学活性を持たないものを用いれば一般合成触媒として用いることができ、また、この配位子に光学活性を有するものを用いれば不斉合成触媒として用いることができ、かつ、簡単な操作で、収率よく目的の錯体を得、しかも触媒活性度の高い新規なルテニウム錯体を見いだし、ここに本発明を完成するに到った。

【0008】すなわち、本発明は、以下のとおりである。

1. 一般式(1)、

 $\{RuX(L)\}, (\mu-X), \}$ $\{R^i, NH, \}$ i (1) $(式中、R^i は、水素、炭素数 <math>1\sim 5$ のアルキル基、シクロアルキル基、置換基を有してもよいフェニル基、置換基を有してもよいペンジル基を表し、Lは、一般式 (2)、

[0009]

$$\begin{array}{c}
0 \\
0 \\
PR^{1_{2}}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
0 \\
PR^{1_{2}}
\end{array}$$

【0010】(式中、R¹ は置換基を有してもよいフェニル基、ナフチル基を表すか、シクロヘキシル基、シクロペンチル基を表す。)で表されるジホスフィン配位子であり、Xはハロゲン原子を意味する。)で表されるルテニウムーホスフィン錯体。

【0011】2. 一般式(3)、

$$(RuX(arene)(L))X$$
 (3)

(式中、Xはハロゲン原子を表し、arene は置換基を有 してもよいフェニル基を表し、Lは一般式(2)、

[0012]

[化5]

$$\begin{array}{c}
0 \\
0 \\
PR^{1}z
\end{array}$$

【0013】(式中、R'は置換基を有してもよいフェニル基、ナフチル基を表すか、シクロヘキシル基、シクロペンチル基を表す。)で表される三級ジホスフィン配位子を意味する。)で表されるルテニウム錯体と、一般式(4)、

$$R^2$$
, NH · HX (4)

(式中、R² は、水素、炭素数 1 ~ 5 のアルキル基、シクロアルキル基、置換基を有してもよいフェニル基、置換基を有してもよいベンジル基を表し、X はハロゲン原 子を意味する。)で表されるアンモニウム塩とを反応させることを特徴とする、一般式(1)、

$$\{RuX(L)\}_{2}(\mu-X)_{3}\}_{1}^{2}(R^{2},NH_{2})_{1}^{2}$$
 (1)

で表されるルテニウム-ホスフィン錯体の調製方法。

【0014】3. 一般式(5)、

(式中、Xはハロゲン原子を表し、arene は置換基を有してもよいフェニル基をを意味する。) で表されるルテニウム錯体と、一般式(2)、

[0015]

30 【化6】

【0016】 (式中、R¹ は置換基を有してもよいフェニル基、ナフチル基を表すか、シクロヘキシル基、シクロペンチル基を表す。) で表される三級ジホスフィン配40 位子と、一般式(4)、

$$R^2$$
, $NH \cdot HX$ (4)

(式中、R¹ は水素、炭素数1~5のアルキル基、シクロアルキル基、置換基を有してもよいフェニル基、置換基を有しても良いベンジル基を表し、Xはハロゲン原子を意味する。)で表されるアンモニウム塩とを反応させることを特徴とする、一般式(1)、

[{RuX(L)},(
$$\mu$$
-X),] [R',NH,] (1) で表されるルテニウムーホスフィン錯体の調製方法。

【0017】4. 前記第1項記載のルテニウムーホス

0 フィン錯体からなるアリルアルコール、オレイン酸及び

5

ケトン類に用いる不斉水素化触媒。

【0018】以下、本発明を詳細に説明する。本発明の新規なルテニウム-ホスフィン錯体は、前述したように、一般式(1)、

[{RuX(L)},(μ -X),] (R',NH,] (1) で表され化合物である。

【0019】上記一般式(1)中、Lで表される三級ジホスフィンの具体例は、一般式(2)、

[0020]

[化7]

$$\begin{array}{c}
0 \\
0 \\
PR^{1}z
\end{array}$$
(2)

[0021] において、 R^1 がフェニル基である(5, 6), (5', 6') - ビス (メチレンジオキシ) ビフ ェニルー2, 2'ージイル) ビス (ジフェニルホスフィ ン) (以下、SEGPHOS と略す) の他、R' が、4-メチ ルフェニル基、4-tert-ブチルフェニル基、3-メチ ルフェニル基、3,5-ジメチルフェニル基、3,5-ジtert-プチルフェニル基、4-クロロフェニル基、4 - フロロフェニル基、4-トリフロロメチルフェニル 基、4-メトキシフェニル基、3,5-ジメトキシフェ ニル基、3,4-メチレンジオキシフェニル基、3,5 -ジメチル-4-メトキシフェニル基、3,5-ジtert - ブチル-4-メトキシフェニル基、2-ナフチル基、 1-ナフチル基、シクロヘキシル基、シクロペンチル基 で表されるホスフィン化合物を挙げることができる。好 ましくは、フェニル基、4-メチルフェニル基、4-te rt-ブチルフェニル基、3,5-ジメチルフェニル基、 3, 5-ジメチル-4-メトキシフェニル基、3, 5-ジtert-ブチルフェニル基、シクロヘキシル基、等であ る。一般式(1)中のXとしては、塩素、臭素及びヨウ 素原子が挙げられる。

【0022】このような、本発明の一般式(1)で示されるルテニウムーホスフィン錯体は、前記した二種の方法(前記2及び3)によって調製することができる。このような方法で調製することによって、錯体を精製することなく、純粋かつ単一の生成物として調製することができる。

【0023】一般式(3)中の areneとしては、ベンゼン、トルエン、キシレン、メシチレン、pーシメン、クメン、ヘキサメチルベンゼン、エチルベンゼン、安息香酸メチル、安息香酸エチル、アニソール、クロルベンゼン、ジクロロベンゼン、ブロモベンゼン、フロロベンゼン等が挙げられる。一般式(3)中のXとしては、塩素、臭素及びヨウ素原子が挙げられる。

【0024】 一般式(4) 中の R^{1} は、置換基を有して 50 級ジホスフィンしとをメタノール、エタノール、ベンゼ

もよいフェニル基、ナフチル基を表すか、シクロヘキシル基、シクロペンチル基である。一般式(5)中のX及びarene は上述したものと同一である。

【0025】本発明の、一般式(3)で表される化合物のうちarene が置換基を有してもよいフェニル基であるところのルテニウム錯体 (RuX(arene)(L)) X は、次のようにして製造することができる。

【0026】 Xが塩素の場合、すなわち、 [RuCl(arene)(1)] Clは、例えば、文献 G. Wikhaus, J. Org. Che
10 m., 41 巻、487 頁 1976 年、あるいはR. A. Zelonka,
Can. J. Chem., 50 巻、3643頁、1972年の方法により調製した [RuCl.(arene)], を原料とし、これと三級ジホスフィンLを、メタノール、エタノール、ベンゼン、塩化メチレンのような溶媒中あるいはこれらの混合溶媒中、20~50℃で1~3時間反応せしめた後、溶媒を滅圧下にて留去することで、定量的に合成することができる。

[0027] また、Xが臭素原子あるいはヨウ素原子の場合、すなわち、 [RuBr(arene)(L)] Brあるいは [RuI(arene)(L)] I は、例えば、まず、 [RuCl,(arene)], を原料とし、これに次式(6)、

$$M^{1} Z \tag{6}$$

(式中、 M^1 はL i、N a 又はK の金属を意味し、Z は B r または I を意味する。)で表される塩を、溶媒として水を用いて反応させるか、あるいは、 [RuCl, (arene)], E とを、溶媒として塩化メチレンー水を用いて、次式(T)、

$$R^4 R^5 R^5 R^7 QX^1 \tag{7}$$

(式中、R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ は炭素数1~16のア 30 ルキル基、フェニル基、ベンジル基を意味し、Qは窒素原子、又はリン原子を意味し、X¹ はハロゲン原子を意味する。)で表される四級アンモニウム塩又は四級ホスホニウム塩を相間移動触媒として使用し、室温で撹拌することにより [Ru2, (arene)], を得る。

[0029] 次いで、得られた [RuZ, (arene)], と三 級ジホスフィンI.とをメタノール、エタノール、ペンゼ

ン、塩化メチレンのような溶媒中あるいはこれらの混合 溶媒中、20~50℃で1~3時間反応せしめた後、溶 媒を減圧下にて留去することで定量的に [RuBr(arene) (L)] Br又は [Rul(arene)(L)] I を合成することがで きる。

【0030】かくして得られた (RuX(arene)(L)) X を 中間体として、本発明の錯体の一つである〔 {RuCl(SEG PHOS) } , (μ-C1),] [Et, NH,] は、例えば次のご とくして製造することができる。

錯体と Et,NH・HCl とを、テトラヒドロフラン (THF)、 ジオキサン、ジメトキシエタン(DME)、ジメチルホルム アミド(DMF)、ジメチルアセトアミド(DMA)、ジオキソ ランなどの溶媒中、50~100℃で5~20時間反応 せしめた後、溶媒を留去することにより、〔{RuCl(SEG PHOS) } , (μ-C1),] [Et, NH,] を定量的に合成で きる。

【0032】また、 [RuZ, (arene)], を中間体とし て、例えば、これに、SEGPHOS と Et,NH・HCl とを、テ トラヒドロフラン(THF) 、ジオキサン、ジメトキシエタ 20 ン(DME)、ジメチルホルムアミド(DMF)、ジメチルアセ トアミド(DMA)、ジオキソランなどの溶媒中、50~1 00℃で5~20時間反応せしめた後、溶媒を留去する ことにより、 [$\{RiuCl(SEGPHOS)\}_{2}(\mu-Cl)_{2}$] [Et ,NH,〕 を定量的に合成できる。

【0033】かくして、本発明のルテニウムーホスフィ ン錯体は、精製することなく、純粋かつ単一の生成物と して合成することができる。得られた本発明のルテニウ ムーホスフィン錯体は、³¹P-NMR等の分析により純 粋な錯体であることが確認された。

【0034】本発明のルテニウムーホスフィン錯体は、 安定な錯体であり、これを不斉水素化反応に用いれば、 非常に高い活性を示す。すなわち、基質に対して1/1 00~1/10000モル濃度の本発明のルテニウムー ホスフィン錯体を用いることにより、反応は速やかに進 行し生成する水素化物の純度、光学純度に優れた結果を 得ることができる。

【0035】本不斉水素化に用いられる基質としては、 【0031】すなわち、 [RuCl(benzene)(SEGPHOS)] Cl 10 ゲラニオール、ネロール等のアリルアルコールやチグリ ン酸、デヒドロナプロキセン、イタコン酸等の α , β -不飽和カルボン酸等のオレフィン酸、及び、アセト酢酸 メチル、4-クロロアセト酢酸メチル、2-オキソー4 - フェニルブタン酸エチル、2-オキソプロパノール、 2, 4-ペンタンジオン等のケトン類が挙げられる。 [0036]

> 【発明の効果】本発明の新規なルテニウムーホスフィン 錯体は、安定な錯体であり、これを触媒として、アリル アルコール、オレフィン酸及びケトン類等の不斉水素化 に用いれば、非常に高い活性を示し、生成する水素化物 の純度、光学純度に優れた結果を得ることができる。ま た、本発明の製造方法は、精製を必要とせず、ルテニウ ムーホスフィン錯体を純粋かつ単一の生成物として合成 することができる。

[0037]

【実施例】以下に実施例によって本発明をさらに具体的 に説明するが、本発明はこれらによって何ら限定される ものではない。なお、各実施例における物性の測定に用 いた装置は次のとおりである。

NMR AM400 (Bruker 社製)

(400MHz;内部標準:テトラメチルシラン) 1 H-NMR

40

3 1 P-NMR (162MHz;内部標準:85%リン酸)

GLC 5890-II (Hewlett Packard社製)

[0038]

【実施例1】 [{RuCl((S)-SEGPHOS) } ,(μ-Cl);] [Et, NH,] [†] の合成

(RuCl, (benzene)), (50mg, 0.1mmol), (S)-SEGPHOS (122mg, 0.2mmol)をシュレンク管に秤取り、窒素置換を し、脱気塩化メチレン(5ml) とエタノール(5ml) を加 え、50℃で2時間撹拌した。反応溶液を濃縮したとこ ろ、茶褐色の固体として、 [RuCl(benzene)((S)-SEGPHO S)] Clが得られた(0.17g、収率98%)。

[OO39] (RuCl(benzene)((S)-SEGPHOS)) Cl (0.17 g, 0.2mmol)とジエチルアミン塩酸塩(54mg, 0.5mmol) とをシュレンク管に秤取り、窒素置換をし、脱気1,4 -ジオキサン(20ml)を加え、環流下16時間撹拌した。 反応溶液を濃縮したところ、茶褐色の固体として表題化 合物が得られた(0.18g、収率98%)。

 3 P-NMR (CDCl₃) δ ; 51.24(d, J = 39.0 Hz), 52.9 (d, J = 39.1 Hz

[0040]

【実施例2】 [{RuCl((R)-SEGPHOS) },(μ-Cl),] [Me, NH,] o合成

(RuCl₂ (benzene)) ₂ (50mg , 0.1mmol) , (R)-SEGPHOS (122mg, 0.2mmol)とジメチルアミン塩酸塩(16mg, 0.2 mmol)とをシュレンク管に秤取り、窒素置換をし、脱気 THF(10ml)を加え、還流下16時間撹拌した。反応溶 液を濃縮したところ、茶褐色の固体として表題化合物が 得られた(0.16g、収率95%)。

 3 P-NMR (CDCl₂) δ ; 51.29 (d, J = 38.3 Hz), 51.72 (d, J = 38.4 Hz)

[0041]

【実施例3】不斉水素化例1: 2-オキソプロパノー

実施例2で得られた錯体 [{RuCl((R)-SEGPHOS) }

, $(\mu - C1)_3$] Me_2NH_2 (110.7mg, 0.14mmol) .

50 2-オキソプロパノール(101g, 1.36mol)、メタノール

200mlを1000mlのステンレスオートクレーブ に入れ、水素圧30atm、65℃で8時間かき混ぜ た。反応液をガスクロマトグラフィー(GLC)にて測 定したところ、転化率99.8%であった。反応液を蒸 留すると、(R)-1, 2-ジヒドロキシプロパン96.5 g (収率95.5%、不斉収率98%ee) が得られた。

[0042]

GLCカラム

転化率:

FFAP $25m \times 0.35mm$

Inj. temp. : 220℃

Det. temp.: 250℃

光学純度:

 α DEX120 30m \times 0.25mm

Inj. temp.: 220℃

Det. temp.: 250℃

[0043]

【比較例1】2-オキソプロパノールの水素化

転化率100%、不斉収率92、8%eeであった。

[0044]

【実施例 $4\sim9$ 】 実施例 $4\sim6$ は実施例 2 と同様に、また、実施例 $7\sim9$ は実施例 1 と同様に行い、結果を表 1 に示した。

[0045]

【表1】

| 実施例 | L | х | R² | ³¹P NMR (CDCI₃)δ |
|-----|--------------|----|------|--|
| 4 | To1-SEGPHOS | C1 | Ме | 49. 80 (d, J=38. 5 Hz) 50. 26 (d, J=39. 0 Hz) |
| 5 | DM-SEGPHOS | C1 | Et | 51. 31 (d, J=42. 0 Hz) 54. 84 (d, J=41. 0 Hz) |
| 6 | DMM-SEGPHOS | C1 | Et | 50. 08 (d, J=41. 0 Hz) 52. 72 (d, J=41. 0 Hz) |
| 7 | SEGPHOS | Вг | Et | 50. 94 (d, J=36. 0 Hz) 50. 26 (d, J=36. 0 Hz) |
| 8 | SEGPHOS | C1 | i-Pr | 50. 97 (d, J=39. 0 Hz) 52. 63 (d, J=39. 0 Hz) |
| 9 | t-Bu-SEGPHOS | C1 | Et | 49. 96 (d, J=39. 0 Hz) 50. 21 (d, J=41. 0 Hz) |

(注) L中のR は、以下の構造式で示される。

CH3

CH3

CH3

キソプタン酸エチルの水素化

実施例2で得られた錯体 [{RuCl((R)-SEGPHOS) } , (μ-Cl),] [Me, NH,] ' (122.3mg, 0.15mmol) 、 4 ークロロー2ーオキソブタン酸エチル(60.9g, 0.37mol)、エタノール183mlを500mlのステンレスオートクレーブに入れ、水素圧30atm、90℃、2時

11

間かき混ぜた。反応液をGLCにて測定したところ、転化率99.8%であった。反応液を蒸留すると、(S) -4- クロロ-2- オキソブタン酸エチル54.6g (収率88.5%、不斉収率98.5% e e) が得られた。

[0047]

GLCカラム

転化率:

NEUTRA BOND-1 $25 \,\mathrm{m} \times 0.25 \,\mathrm{mm}$

Inj. temp. : 230℃ Det. temp. : 250℃

光学純度:

Chiraldex G-TA $30m \times 0.25mm$

Inj. temp. : 200℃ Det. temp. : 200℃

[0048]

【比較例2】4-クロロ-2-オキソプタン酸エチルの

水素化

4-クロロ-2-オキソブタン酸エチル (3.29g, 20mm

ol) と、 [{RuCl((R)-BINAP) } , (μ-Cl),] [Et ,NH,] ' 6.8mg, 4mmol)、E t O H (5.4ml)とを、水素 圧 1 O a t m、 1 O 0 ℃で 2 時間かき混ぜた。不斉収率

を測定したところ、95.3% e e であった。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号 方

庁内整理番号

FΙ

69/716

技術表示箇所

Z

69/716

// C07B 61/00

300

C07B 61/00

300